

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成25年8月1日(2013.8.1)

【公表番号】特表2011-529440(P2011-529440A)

【公表日】平成23年12月8日(2011.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2011-049

【出願番号】特願2011-521172(P2011-521172)

【国際特許分類】

C 01 B	39/48	(2006.01)
B 01 J	29/70	(2006.01)
C 07 C	2/66	(2006.01)
C 07 C	15/085	(2006.01)
C 10 G	35/095	(2006.01)
C 07 B	61/00	(2006.01)

【F I】

C 01 B	39/48	
B 01 J	29/70	Z
C 07 C	2/66	
C 07 C	15/085	
C 10 G	35/095	
C 07 B	61/00	3 0 0

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年6月14日(2013.6.14)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

モレキュラーシーブであって、

合成されたままの形態および焼成形態では、X線回折パターンは14.17オングストロームから12.57オングストロームの範囲で格子面間隔dの最大値のピークを有し、さらにX線回析パターンは12.1オングストロームから12.56オングストロームの範囲で格子面間隔dの最大値のピークを有し、さらに

(i) 8.85オングストロームから11.05オングストロームの間は非分離拡散であるか、または、(ii) 10.14オングストロームから12.0オングストロームの範囲の格子面間隔dの最大値のピークと、8.66オングストロームから10.13オングストロームの範囲の格子面間隔dの最大値のピークとの間に谷を示し、最下点でバックグラウンドに対して補正された測定強度が、10.14オングストロームから12.0オングストロームの範囲の最大値と、8.66オングストロームから10.13オングストロームの範囲の最大値とを接続する線上の同一のXRD格子面間隔dポイントの50%以上であり、

合成されたままの形態および焼成形態では、X線回折パターンはさらに3.57±0.07オングストローム、3.42±0.07オングストローム、および6.9±0.15オングストロームでピークを含むモレキュラーシーブ。

【請求項2】

請求項1に記載のモレキュラーシーブであって、

以下のモル関係の組成物を有するモレキュラーシープ。

$X_2O_3 : (n) YO_2$ 、

(Xはアルミニウム、ホウ素、鉄およびガリウムの少なくとも1つを含有する三価元素であり、Yはケイ素およびゲルマニウムの少なくとも1つを含有する四価元素であり、nは少なくとも10である。)

【請求項3】

請求項2に記載のモレキュラーシープであって、

合成されたままの形態では、無水ベースで YO_2 のnモルに対する酸化物のモルを単位として、以下の式を有するモレキュラーシープ。

(0.005-1) M_2O : (1-4)R : X_2O_3 : n YO_2

(Mはアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり、Rは有機部分である。)

【請求項4】

請求項2または3に記載のモレキュラーシープにおいて、

前記nは10から150であるモレキュラーシープ。

【請求項5】

請求項1に記載のモレキュラーシープにおいて、

コリジン吸着容量が少なくとも150μモル/gであるモレキュラーシープ。

【請求項6】

請求項1に記載の合成されたままの結晶性モレキュラーシープEMM-12を製造する方法であって、

(a) EMM-10-P族組成物と、酸性組成物とを含有し、空間剤を含有してもよい混合物を供給する工程と、

(b) 混合物を処理条件下で処理して合成されたままのEMM-12を含有する生成物を形成する工程と、

(c) 酸処理された結晶性モレキュラーシープを回収する工程とを含み、前記EMM-10-P族組成物はEMM-10-Pを含有し、前記酸性組成物は1Nの硝酸水溶液を含有し、前記空間剤はジエトキシジメチルシランを含有し、前記処理条件には90～170の範囲の温度と、1時間～24時間の範囲の時間が含まれる方法。

【請求項7】

焼成された結晶性モレキュラーシープEMM-12を製造する方法であって、

請求項6に記載された前記合成されたままの結晶性モレキュラーシープEMM-12を焼成条件で焼成する工程を含む方法。

【請求項8】

炭化水素転化プロセスであって、炭化水素供給原料を請求項1に記載の前記結晶性モレキュラーシープEMM-12と炭化水素転化条件下で接触させる工程を含む方法。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0062

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0062】

実施例1

米国特許出願番号第11/823,129の実施例1に従って作製されたEMM-10-P(1.5g)のサンプルを、30gの1M硝酸及び0.3gのジエトキシジメチルシランの混合物に添加した。オープンの中で、パルボム(ParrTM bomb)で密閉されたテフロン容器中にて、170度24時間反応を行った。固体の生成物をろ過して単離し、洗浄し、120度乾燥させた。

XRD回折パターン(図2)は、6.5～7.1度2(Cu K)に対応する12.45オングストロームから13.60オングストローム間に二重線のピークがあり、8～10度2(Cu K)領域に対応する8.85から11.05オングストロームの間は非分離拡散であり、または11.05±0.18オングストロームでのピークと9.

31 ± 0 . 13 オングストロームでのピークとの間で谷を示すが、最下点でバックグラウンドに対して補正された測定強度は、11 . 05 ± 0 . 18 オングストロームの近傍と 9 . 31 ± 0 . 13 オングストロームの近傍との最大値を接続する線上の同一の XRD 格子面間隔 d ポイントの 50 % 以上である。

焼成された生成物は $523 \text{ m}^2 / \text{g}$ という大きい表面面積および $321 \mu\text{モル/g}$ という非常に大きなコリジン吸着量を示した。

いかなる理論にも拘束されることを意図しないが、XRD によって示された層間隔が保持されることで、追加の熱安定部分が挿入されることが示され、可能性が最も高いのは Si 原子の取り込みであるとわれわれは信じる。NMR の結果はこの理論と一致する。